

高真空蒸着装置 RD-1300



高真空蒸着装置 RD-1300 は、Au、AuZnNi、AuGeNiをウエハ基板に成膜する為の装置です。メイン排気系はクライオポンプを採用し、蒸発源は抵抗加熱により構成されています。抵抗加熱機構はポリウムによる手動操作またはプログラムコントローラによる自動操作を切替スイッチにて切替えることが可能です。基板冷却機構も付加されております。

高真空蒸着装置RD-1300仕様

- 到達圧力 3.0×10⁻⁶Pa※常温・無負荷時
- 排気速度 2.0×10⁻⁵Paまで60分以内※常温・無負荷時
- 真空漏洩量 1.0×10⁻¹⁰Pa・m³/sec Heリークデテクター検査
- 真空室径 φ400mm×490mmH SUS304 電解研磨
- 開閉方法 モーター機構による上下開閉
- 蒸着機構 抵抗加熱方式3対切替式(フィラメント)
AC10V0~150A
制御方式:サイリスタ制御
電圧計・電流計・可変ポリウム
- 基板冷却 -20℃~常温(低温恒温水槽装置)
- 真空排気系 ドライポンプ:250L/min[50Hz]
クライオポンプ:4000L/sec(H₂O)
- 真空計 大気圧検知器/クリスタルイオンゲージ(広帯域真空計)/ピラニ真空計(クライオポンプ内用)
- 操作方法 排気系全自動(手動も選択可)/蒸着機構(手動/自動切替可能)/クライオ自動再生機構
- ユーティリティ電気:AC200V三相10KVA AC100V単相20A
冷却水:2L/min以上0.1MPa以上0.15MPa以下25℃以下循環
計装エア:0.5MPa以上
寸法: 装置架台本体:850mmW×850mmD×(1783)mmH
制御盤:600mmW×600mmD×(2035)mmH
クライオコンプレッサー:332mmW×543mmD×573mmH
低温恒温水槽装置:404mmW×515mmD×925mmH